

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

编号：2026-015

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与机构名称	中信建投、东方证券、万家基金、工银瑞信、测度基金
时间	2026.7.29 中信建投 2026.7.30 东方证券、万家基金、测度基金、工银瑞信
地点	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋
公司接待人员姓名	董事会秘书 庄丽华 董事、战略总监 刘涛 投资者关系专员 郝一骏
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问公司目前的营收结构、在手订单及客户拓展情况如何？ 回答：2025年公司实现营业收入约 5.29 亿元，以来自自研产品的收入为主，主要客户为拓荆科技、宏大真空、中微公司、北方华创、微导纳米等。2026年一季度公司实现营业收入 1.24 亿元。截至公司2025年年度报告披露日，公司持有尚未交付的在手订单共约 1.57 亿元。公司将充分发挥研发和技术优势，结合市场发展前景和客户需求，不断进行新产品的研发设计，结合公司丰富的技术和生产经验，加快推动更先进工艺制程等离子体射频电源系统的产业化应用，为客户提供性能更优、可靠性更高的产品，推进公司长期稳定发展。同时，公司还将积极推动主营业务产品向光伏、显示面板、精密光学等领域的拓展，不断提升公司产品性能与质量，并拓宽公司产品品类，致力于成为围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案的平台型公司，助力公司长期稳定发展。 2. 请介绍一下公司自研产品的生产经营模式和产品特性 回答：公司的自研产品主要采取以销定产的生产模式，根据供货要求、产品生产周期、销售预测等因素对生产排期和物料管理进行统筹安排，协调生产、采购和仓储等相关部门保障生产的有序进行。公司的主要自研产品为等离子体射频电源系统，被广泛应用于半导体工艺中的薄膜沉积、刻蚀、离子注入、清洗去胶、键合等环节，也被应用于光伏电池片的薄膜沉积、显示面板镀膜、精密光学镀膜、常压等离子体清洗等工业生产环节。同时，自研产品一般具有高

度定制化的特点，需要根据客户的特定需求进行研发和生产，公司需要与客户保持紧密的沟通和合作，以确保产品能够满足客户的实际需求。

3. 请问公司的射频电源和匹配器都是配套出售的吗？一个腔体需要多少个射频电源？

回答：客户可根据自身需求，单独向公司采购等离子体射频电源或匹配器，亦可以同时采购等离子体射频电源和配套的匹配器。此外，公司等离子体射频电源无需与同系列的匹配器产品配套使用，同系列中的等离子体射频电源和匹配器亦不会有固定的配套关系。同时，在不同的制程的产线中，每台设备的腔体数量有所不同，越先进制程的设备腔体数量更多，对射频电源的需求量也更大。

4. 请介绍一下公司引进产品的应用场景

回答：公司基于等离子体发生条件和反应腔真空环境的实际需求，引进用于获得和维持真空环境的真空泵、用于流体精确控制的质量流量计以及用于真空镀膜装备的等离子体直流电源等核心零部件。公司引进产品和自研产品一同协作，共同为下游客户提供等离子体工艺解决方案。

（1）真空泵：在半导体、工业镀膜等工艺中，将硅片或其他材料放入反应腔室后，需要使反应腔获得真空环境。真空泵是反应腔获取真空环境的核心零部件，用于在反应腔中产生和维持真空环境。

（2）质量流量计：在反应腔获取真空环境后，需要向反应腔室通入工艺气体，工艺气体被等离子体射频电源电离产生等离子体。此时需要通过质量流量计精确计量和输送。质量流量计是反应腔供气系统的核心零部件，用于对气体等进行质量流量的测量和控制。

（3）等离子体直流电源：主要用于真空镀膜装备，即在反应腔内使用等离子体直流电源对靶材施加电压，使气体离子化，产生等离子体。这些离子在电场的作用下加速并轰击靶材，溅射出原子或分子，最终沉积在基材上，完成镀膜。

5. 请介绍一下公司上游元器件的国产化进程

回答：公司已建立稳定、高质量的供应商体系，关注供应商经营资质、生产能力、技术水平、质量管控水平以及产品价格等多方面因素，并结合响应速度、付款条件等对供应商进行综合评定，将符合要求的供应商列入合格供应商名录，并在供货阶段实行供应商动态管理，筛选优质供应商，持续优化采购渠道。为保证生产的连续和稳定性，公司综合考虑原材料的采购周期、供应商的供货能力、采购量起订门槛等因素，对常用材料建立安全库存机制。自 2021 年开始，公司先后在上游采购中实现了真空电容、陶瓷电容、MCU 以及 SiC MOS、LDMOS、部分 ADC 和 FPGA 等元器件的国产化应用。公司目前已确定上游元器件的全国产化方案，将持续推进元器件的全面国产化验证工作。

6. 请问2025年研发投入增长的原因？

回答：2025年，公司研发投入金额达到 8,015.92 万元，同比增长 45.01%，主要系公司研发投入中人工费同比增长61.43%，公司持续加大研发投入力度，提高技术指标要求，推进新产品开发、产品持续升级迭代等，不断加强产品竞争力。

7. 请介绍一下公司目前的产能情况及产能未来布局

	回答： 2025年公司产能利用率达 98.51%。公司通过多个措施提升产能，包括积极推进子公司恒运昌真空技术（沈阳）有限公司的建设与正式运营，助力其实现从试产到量产的跨越；同时推进深圳产能建设，加速产能落地；公司未来将逐步推进半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目的建设，这些都将有助于后续产能的释放，为公司产能持续提升奠定基础。
--	---

以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。